ポリカルボシラン微粒子由来の白色・発光性 Si-0-C(-H) セラミックスの 合成における酸化不融化が及ぼす影響と構造評価

Structural characterization of white PL Si-O-C(-H) ceramics derived from polycarbosilane particles under influences of oxidation curing

成澤雅紀 a, 外薗洋樹 a, 光原圭 b, 小川雅裕 b, 井上博史 a, 太田俊明 b Masaki Narisawa^a, Hiroki Hokazono^a, Kei Mitsuhara^a, Masahiro Ogawa^b, Hirofumi Inoue^b, Toshiaki Ohta^a

^a 大阪府立大学大学院工学研究科,^b立命館大学 SR センター ^aGraduate School of Engineering, Osaka Prefecture University, ^bThe SR Center, Ritsumeikan University

ポリカルボシラン微粒子に対して熱酸化不融化を施すことによって、酸素導入量の異なる有機ケ イ素前駆体を調製した。800℃および 1100℃での水素脱炭により Si-O-C(-H)セラミックスを得た。 生成物の白色性・発光性を観測し、FT-IR スペクトルと Si K-edge に関する X 線吸収端スペクトル から、発光性とアモルファス構造の関係性について検討を行った。基本的に SiCO₃ユニットと SiO₄ ユニットの混在が発光に有利であり、SiC₄ユニットの存在は阻害的に働く傾向が見られた。

Organosilicon precursors with various oxygen contents were prepared from thermal oxidation-cured polycarbosilane (PCS) particles, and Si-O-C(-H) ceramics were obtained from these precursors by decarbonization reaction at 800 °C and 1100 °C. Whiteness and PL properties of the obtained products were estimated and their structures were evaluated in terms of FT-IR and Si K-edge X-ray absorption near edge structure (XANES) spectra. Intrinsically mixture states of SiCO₃ and SiO₄ units were favored to obtain strong PL materials, whereas existence of SiC₄ units had negative effect on PL properties.

Keywords: Silicon oxycarbide, Polycarbosilane, Oxidation curing, Decarbonization reaction, Si K-XANES

<u>背景</u>:ポリカルボシラン (Polycarbosilane: PCS)はSi-C 主骨格から成る有機ケイ素高分 子であり、炭化ケイ素系セラミックス繊維の 前駆体として、広く知られている[1]。特に溶 融紡糸、電子線不融化、水素脱炭を組み合わ せたプロセスは、繊維耐熱性の向上に有効で あることが知られ、近年、多大な注目を集め ている。一方、我々は近年、主骨格が Si-O の 繰り返し単位から成るポリシロキサン系の前 駆体に対し、水素脱炭焼成を施した場合、白 色性に富むとともに近紫外励起によって PL 特性を示す特異なアモルファスセラミックス を得ることに成功した[2]。本合成法をベース として、一般には水素脱炭時に黒色の生成物 を与える PCS 前駆体でも、微粒子化、酸素導 入後に脱炭焼成を行うことで白色化および発 光性に至るのではないかと考えた。PCS 前駆 体から一連のプロセスを経て得られる Si-O-C(-H)セラミックスについて、脱炭焼成 後の白色化、発光性、セラミックス収率、Si-C 結合の切断、Si-O 結合の生成、Si 原子周りの

局所構造について調査した。白色性や発光性 に対するアモルファス構造の影響を、特に Si-O 結合と Si-C 結合の量比の観点から見積 もることを目的としている。 実験:前駆体としては日本カーボン製PCS

(NIPUSI TYPE A、化学組成: SiC1.87H1.45 **O**_{0.02})を用いた。再沈・真空乾燥によって得 られたPCS粒子約0.3gに対し、乾燥空気流通 下で、一定温度(200,240,290,340,400℃) まで昇温し、そのまま10h保持することによ って、熱酸化不融化を行った。さらに各不融 化粒子に対して、水素流通下800℃ 1h保持、 あるいは1100℃ 3h保持を行うことによって、 各前駆体あたり2種のSi-O-C(-H)セラミック ス粒子を得た。白色性やUV光(350-360 nm領 域)下での発光性を観察し、構造について、 FT-IRスペクトルおよびSi K-edge XANESス ペクトルの測定を行った。XANES測定は立命 館大学SRセンターBL-13で実施し、分光結晶 にはInSb (111)を用いた。表面の影響を避け、 試料深部全体の情報を得るため、評価モード

には部分蛍光収量法 (PFY) を採用し、測定・ 解析を行った

結果、および、考察: 熱酸化不融化により、 いずれも粒子質量は増加しているが、特に 200℃ (10.9%)、および 340℃ (11.0%) での 質量増加が著しい。200℃不融化で重量増加が 著しいのは、OH 基の残存、340℃熱酸化の重 量増加は Si-CH₂-Si 主鎖構造の断裂酸化によ るものと考えられる。熱酸化後にさらに脱炭 焼成を行った後の外観、発光性を Table 1 にま とめた。800℃脱炭の段階では、いずれも白色 であり、有意な差は認められないが、1100℃ 脱炭では、240℃酸化を経た焼成物は黄色とな り、400℃酸化を経た焼成物は灰色を示した。 また紫外照射下での発光については、290℃、 340℃、400℃不融化物について見られるが、 中でも 340℃不融化が高い発光性を示した。 発光性は 1100℃脱炭でも維持されているが、 800℃脱炭に比べて、強度自体は微弱となる。

Table 1. Apparent colors of Si-O-C(-H) ceramics.

Curing Temp.	200°C	240°C	290°C	340°C	400°C
800 °C decarb. 1100C decarb.	white (no PL) brown (no PL)	white (weak blue) yellow (no PL)	white (weak blue) white (weak brown)	white (blue) white (white)	white (partly blue) grey (weak grey)

(): PL color under 360-360 nm UV

800℃脱炭時に高い発光性を示すサンプル に関して、FT-IR スペクトルを測定した結果 を Fig.1 に示す。最も高い発光性を示すサン プルでは1100 cm⁻¹ピークと 800 cm⁻¹の強度比 が 0.28 であり、これは既報のポリシロキサン 系前駆体 800℃脱炭時に観測されるピーク強 度比 0.26 と近しい。またこれらのスペクトル はいずれも、880 cm⁻¹にショルダーを有して いる。1100℃脱炭でも、このショルダーは完 全には消失せず、ピークの平坦化という形で 残存している。水素脱炭のケースにおいて一 般に強く表れることから、Si₃CH ユニットの 中の Si-C 結合に帰属される可能性が高い。

同じく発光性を維持する三種の脱炭焼成物 のXANES スペクトルを Fig. 2 a), b)に示す。 800℃脱炭焼成においては、基本的に SiO₃C ユニットと SiO₄ ユニットが混在しているこ とが分かった。290℃では、吸収端が低エネル ギー側に位置し、SiC₄ ユニットが幾分混在し ているものと思われる。その一方、比較的発 光性が低く、不均一である 400℃不融化では SiO4ユニットが大半を占めていることが分か った。

<u>文</u>献

[1] M. Takeda et al., J. Am. Ceram. Soc., 83, 1063–9 (2000).

[2] M. Narisawa et al., *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **85**, 724–6 (2012).

学会等発表

[1] 外薗洋樹、成澤雅紀、井上博、小川雅裕、 太田俊明

第 28 回日本セラミックス協会秋季シンポジ ウム (9月、富山)

[2] M. Narisawa, H. Hokazono, A. Iwase, H. Inoue, M. Ogawa, T. Ohta

The 3rd International Conference on Powder Metallurgy in Asia: APMA2015 (Nov. 8-10th, 2015, Kyoto, Japan)



Fig. 1. FT-IR spectra of H_2 800 with various curing conditions.



Fig. 2. Si K-XANES spectra of H₂ 800 with various curing conditions.